

高真空蒸着装置 ED-1500Rスタンダード型



高真空蒸着装置ED-1500Rスタンダード型は抵抗加熱と電子銃を標準装備しております。有機物、金属、貴金属、酸化物の成膜も容易にできます。電子銃のルツボは1mlを3点、抵抗加熱も3点有しておりますので、多層膜の成膜も可能です。また水晶振動式膜厚計を標準装備しておりますので、膜厚監視も可能です。排気系はクリーンポンプとしてターボ分子ポンプを採用しておりますので、オイルミストも気になりません。

高真空蒸着装置ED-1500Rスタンダード型仕様

- 到達圧力 7.0×10⁻⁴Pa以下※常温・無負荷・脱ガス時
- 真空室径 φ500mm×550mmH SUS304 電解研磨
- 蒸着機構 電子銃最大投入電力:2KW
ルツボ容量:1.0ml
ルツボ个数:3個
抵抗加熱最大電力:AC5/10V0.5KVA
抵抗電極数:3対(バスケット状フィラメント)
- 基板形状 27mm×70mm 2枚
- 膜厚計 水晶振動式膜厚計
- 真空排気系 油回転ポンプ:670/800L/min[50Hz/60Hz]
ターボ分子ポンプ:300L/sec
- 真空計 大気圧検知器/ピラニ真空計/電離真空計
- 制御系 ターボ分子ポンプコントローラ
- 操作方法 手動
- ユーティリティ電気:AC200V三相5KVA
冷却水:6L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環
寸法: 装置架台本体:950mmW×870mmD×(1513)mmH
制御盤:510mmW×800mmD×(1860)mmH